

平成29年度 第2回電子デバイス事業化フォーラムの開催について

公益財団法人 ちゅうごく産業創造センター（会長：迫谷 章）は、半導体・電子デバイス製造装置分野の市場動向や最先端技術等についての講演などを通じて地域ネットワークの拡充や事業化促進を図ることを目的に「平成29年度第2回電子デバイス事業化フォーラム」を下記のとおり開催いたしますのでお知らせします。

さて、第1回のフォーラムではグローバルな視点から「世界半導体および周辺産業の現状と将来展望」を取り上げました。今回は「最先端半導体デバイス技術の動向」について、ご紹介します。

まず、集積回路(IC)が創る未来社会を実現するテクノロジーとして、近接場結合3次元集積技術、エネルギー高効率コンピュータ、スマートセンサ、人工知能を研究されている慶應義塾大学理工学部電子工学科の黒田教授より「脳・AI・3D集積 -シリコン脳を創る-」と題して、ご講演をいただきます。

次に、長年に渡って、集積回路の製品開発、新材料、パワーデバイス、RF CMOSなどの技術開発、素子超微細化やその限界追求などの研究に携わってこられた東京工業大学科学技術創成研究院未来産業技術研究所の岩井名誉教授より「微細化終焉後の電子デバイス技術の将来 -その過去・現状と22世紀までの見通し-」と題して、ご講演をいただきます。

そして、今回の大学のシーズ紹介は、表面・界面における不均一化学反応、および表面に形成される特徴ある低次元物質の物性、特異的化学反応に着目した材料開発・評価、そして新しい分析・計測技術を研究されている山口大学大学院創成科学研究科の安達准教授より「自動車部材・電子材料開発に資するシーズ技術紹介」と題して、ご紹介をいただきます。

多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

記

- 開催日時 平成29年9月2日（土） 13:30～17:00
- 開催場所 福山商工会議所（福山市西町2-10-1）
- プログラム
 - ・講演1
題目 「脳・AI・3D集積 -シリコン脳を創る-」
講師 慶應義塾大学 理工学部電子工学科 教授 黒田 忠広 氏
 - ・講演2
題目 「微細化終焉後の電子デバイス技術の将来
-その過去・現状と22世紀までの見通し-」
講師 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所
名誉教授 岩井 洋 氏
 - ・研究シーズ紹介
題目 「自動車部材・電子材料開発に資するシーズ技術紹介
【湿気反応性高速硬化型樹脂化合物・単一微粒子体積磁化率測定】」
紹介者 山口大学大学院 創成科学研究科 准教授 安達 健太 氏
- 参加費 無 料
- 定 員 100名（先着順）
- 申込方法 （公財）ちゅうごく産業創造センターHP（<http://ciicz.jp/>）の申込フォームから
お願いします。
また、E-mail(zdkoryu1@pnet.gr.energia.co.jp) 又は FAX（082-240-2189）
でも受け付けます。 申込締切：平成29年8月25日（金）
- 主 催 公益財団法人ちゅうごく産業創造センター
中国経済産業局
備後半導体技術推進連合会（B I S T E C）

【お問い合わせ先】

（公財）ちゅうごく産業創造センター
担当：高原 智 TEL:082-241-9940



競輪の補助事業

この事業は、競輪の補助を受けて実施します。

<http://hojo.keirin-autorace.or.jp/>